

CZU: 621.793

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4457422>

**STRATURI SUBȚIRI SEMICONDUCTOARE PREPARATE ÎN SISTEME DE
PULVERIZARE CU MAGNETRON (DC): TEORIE vs EXPERIMENT (I)**

*Igor NAROLSCHI, Alexandr CLIUCANOV, Corneliu ROTARU,
Marin RUSU, Sergiu VATAVU*

Universitatea de Stat din Moldova

Caracteristica curent-tensiune a sistemului de pulverizare cu magnetron (DC) depinde în formă pătratică de trei parametri, unul dintre care este egal cu potențialul de aprindere a descărcării gazului, pe când ceilalți doi parametri se determină experimental din caracteristica curent-tensiune pentru valori mici sau mari ale tensiunii aplicate sistemului.

Cuvinte-cheie: *sistem de pulverizare cu magnetron, caracteristica curent-tensiune, descărcare în gaz.*

**SEMICONDUCTOR THIN FILMS PREPARED BY MAGNETRON SPUTTERING (DC):
THEORY vs EXPERIMENT (I)**

The current-voltage dependencies of a DC magnetron system depend, as a square function, on three parameters, one of those being equal to the ignition potential in gas discharge, while the other two are being determined experimentally by use of experimental curves for low/high applied voltages.

Keywords: *magnetron sputtering system, current vs voltage dependence, gas discharge.*

Prezentat la 31.10.2020

Publicat: ianuarie 2021